



FORLAB



**TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DRESDEN**

ALPIN Atomic
Layer
Process
Innovation
Network

Workshop „Atomlagenabscheidung und -ätzen (ALD/ALE)“

Datum: 29.03.2022

Zeit: 15:00 – 17:00 Uhr

Das ForLab Mikroelektronik Dresden für rekonfigurierbare Elektronik (DCST) organisiert zusammen mit dem Atomic Layer Process Innovation Network (ALPIN) einen Workshop zum Thema „Atomlagenabscheidung und -ätzen (ALD/ALE)“ auf der ForLab-Fachtagung „Mikroelektronik-Forschung in Deutschland: Von den Grundlagen zur Anwendung“. Hier sollen Beiträge aus dem ForLab-Verbund und anderen Forschungsbereichen einen Überblick über aktuelle Themen und Entwicklungen im Bereich ALD und ALE geben.

Agenda:

15:00	Welcome and Introduction	Martin Knaut	Technische Universität Dresden
15:15	Opportunities of a customer specific cluster tool for advanced process development for the integration of ALD grown 2D materials	Claudia Bock	Ruhruniversität Bochum
15:35	In situ investigations on atomic layer etching of Al ₂ O ₃	Johanna Reif	Technische Universität Dresden
15:55	First principles insights into atomic level processing chemistries	Michael Nolan	Tyndall National Institute
16:15	Center Nanoelectronic Technologies 2.0 – a brief outlook	Sascha Bönhardt	Fraunhofer IPMS-CNT
16:35	Flash-Lamp Enabled Atomic Layer Deposition of Titanium Oxide	Martin Knaut	Technische Universität Dresden
16:55	Wrap-up and discussion		